

特定化學物質危害預防標準部分條文及第二條附表 一修正條文

- 第 三 條 本標準所稱特定管理物質，指下列規定之物質：
- 一、二氯聯苯胺及其鹽類、 α -萘胺及其鹽類、鄰-二甲基聯苯胺及其鹽類、二甲氧基聯苯胺及其鹽類、次乙亞胺、氯乙烯、3,3-二氯-4,4-二胺基苯化甲烷、四羰化鎳、對-二甲胺基偶氮苯、 β -丙內酯、環氧乙烷、奧黃、苯胺紅、石綿（不含青石綿、褐石綿）、鉻酸及其鹽類、砷及其化合物、鎳及其化合物、重鉻酸及其鹽類（含各該列舉物佔其重量超過百分之一之混合物）。
 - 二、鈹及其化合物、含鈹及其化合物之重量比超過百分之一或鈹合金含鈹之重量比超過百分之三之混合物（以下簡稱鈹等）。
 - 三、三氯甲苯或其重量比超過百分之零點五之混合物。
 - 四、苯或其體積比超過百分之一之混合物。
 - 五、煤焦油或其重量比超過百分之五之混合物。
- 第 七 條 雇主不得使勞工從事製造、處置或使用甲類物質。但供試驗或研究者，不在此限。
- 前項供試驗或研究之甲類物質，雇主應依管制性化學品之指定及運作許可管理辦法規定，向中央主管機關申請許可。
- 第 八 條 雇主使勞工從事試驗或研究甲類物質時，應依下列規定辦理：
- 一、製造設備應為密閉設備。但在作業性質上設置該項設備顯有困難，而將其置於氣櫃內者，不在此限。
 - 二、設置製造設備場所之地板及牆壁應以不浸透性材料構築，且應為易於用水清洗之構造。
 - 三、從事製造或使用甲類物質者，應具有預防該物質引起危害健康之必要知識。
 - 四、儲存甲類物質時，應採用不漏洩、不溢出等之堅固

容器，並應依危害性化學品標示及通識規則規定予以標示。

五、甲類物質應保管於一定之場所，並將其意旨揭示於顯明易見之處。

六、供給從事製造或使用甲類物質之勞工使用不浸透性防護圍巾及防護手套等個人防護具。

七、製造場所應禁止與該作業無關之人員進入，並將其意旨揭示於顯明易見之處。

第九條 雇主使勞工從事製造、處置或使用經中央主管機關指定為管制性化學品之乙類物質，除依管制性化學品之指定及運作許可管理辦法申請許可外，應依本標準規定辦理。

第十條 雇主使勞工從事製造鉍等以外之乙類物質時，應依下列規定辦理：

一、製造場所應與其他場所隔離，且該場所之地板及牆壁應以不浸透性材料構築，且應為易於用水清洗之構造。

二、製造設備應為密閉設備，且原料、材料及其他物質之供輸、移送或搬運，應採用不致使作業勞工之身體與其直接接觸之方法。

三、為預防反應槽內之放熱反應或加熱反應，自其接合部分漏洩氣體或蒸氣，應使用墊圈等密接。

四、為預防異常反應引起原料、材料或反應物質之溢出，應在冷凝器內充分注入冷卻水。

五、必須在運轉中檢點內部之篩選機或真空過濾機，應為於密閉狀態下即可觀察其內部之構造，且應加鎖；非有必要，不得開啟。

六、處置鉍等以外之乙類物質時，應由作業人員於隔離室遙控操作。但將粉狀鉍等以外之乙類物質充分濕潤成泥狀或溶解於溶劑中者，不在此限。

七、從事鉍等以外之乙類物質之計量、投入容器、自該

容器取出或裝袋作業，於採取前款規定之設備顯有困難時，應採用不致使作業勞工之身體與其直接接觸之方法，且該作業場所應設置包圍型氣罩之局部排氣裝置；局部排氣裝置應置除塵裝置。

八、為預防鉍等以外之乙類物質之漏洩及其暴露對勞工之影響，應就下列事項訂定必要之操作程序，並依該程序實施作業：

(一) 閥、旋塞等（製造鉍等以外之乙類物質之設備於輸給原料、材料時，以及自該設備取出製品等時為限。）之操作。

(二) 冷卻裝置、加熱裝置、攪拌裝置及壓縮裝置等之操作。

(三) 計測裝置及控制裝置之監視及調整。

(四) 安全閥、緊急遮斷裝置與其他安全裝置及自動警報裝置之調整。

(五) 蓋板、凸緣、閥、旋塞等接合部分之有否漏洩鉍等以外之乙類物質之檢點。

(六) 試料之採取及其所使用之器具等之處理。

(七) 發生異常時之緊急措施。

(八) 個人防護具之穿戴、檢點、保養及保管。

(九) 其他為防止漏洩等之必要措施。

九、自製造設備採取試料時，應依下列規定：

(一) 使用專用容器。

(二) 試料之採取，應於事前指定適當地點，並不得使試料飛散。

(三) 經使用於採取試料之容器等，應以溫水充分洗淨，並保管於一定之場所。

十、勞工從事鉍等以外之乙類物質之處置作業時，應使該勞工穿戴工作衣、不浸透性防護手套及防護圍巾等個人防護具。

第十一條 雇主使勞工從事製造鉍等之乙類物質時，應依下列規定辦理：

一、鉍等之燒結或煨燒設備（自氫氧化鉍製造高純度氧化鉍製程中之設備除外）應設置於與其他場所隔離之室內，且應設置局部排氣裝置。

二、經燒結、煨燒之鉍等，應使用吸出之方式自匣鉢取出。

三、經使用於燒結、煨燒之匣鉢之打碎，應與其他場所隔離之室內實施，且應設置局部排氣裝置。

四、鉍等之製造場所之地板及牆壁，應以不浸透性材料構築，且應為易於用水清洗之構造。

五、鉍等之製造設備（從事鉍等之燒結或煨燒設備、自電弧爐融出之鉍等製造鉍合金製程中之設備及自氫氧化鉍製造高純度氧化鉍製程中之設備除外）應為密閉設備或設置覆圍等。

六、必須於運轉中檢點內部之前款設備，應為於密閉狀態或覆圍狀態下可觀察其內部之構造，且應加鎖；非有必要，不得開啟。

七、以電弧爐融出之鉍等製造鉍合金製程中實施下列作業之場所，應設置局部排氣裝置。

（一）於電弧爐上之作業。

（二）自電弧爐泄漿之作業。

（三）熔融鉍等之抽氣作業。

（四）熔融鉍等之浮渣之清除作業。

（五）熔融鉍等之澆注作業。

八、為減少電弧爐插入電極部分之間隙，應使用砂封。

九、自氫氧化鉍製造高純度氧化鉍製程中之設備，應依下列規定：

（一）熱分解爐應設置於與其他場所隔離之室內場所。

(二) 其他設備應為密閉設備、設置覆圍或加蓋形式之構造。

十、鉍等之供輸、移送或搬運，應採用不致使作業勞工之身體與其直接接觸之方法。

十一、處置粉狀之鉍等時（除供輸、移送或搬運外），應由作業人員於隔離室遙控操作。

十二、從事粉狀之鉍等之計量、投入容器、自該容器取出或裝袋作業，於採取前款規定之設施顯有困難時，應採用不致使作業勞工之身體與其直接接觸之方法，且該作業場所應設置包圍型氣罩之局部排氣裝置。

十三、為預防鉍等之粉塵、燻煙、霧滴之飛散致勞工遭受污染，應就下列事項訂定必要之操作程序，並依該程序實施作業：

(一) 將鉍等投入容器或自該容器取出。

(二) 儲存鉍等之容器之搬運。

(三) 鉍等之空氣輸送裝置之檢點。

(四) 過濾集塵方式之集塵裝置（含過濾除塵方式之除塵裝置）之濾材之更換。

(五) 試料之採取及其所使用之器具等之處理。

(六) 發生異常時之緊急措施。

(七) 個人防護具之穿戴、檢點、保養及保管。

(八) 其他為防止鉍等之粉塵、燻煙、霧滴之飛散之必要措施。

十四、勞工從事鉍等之處置作業時，應使該勞工穿戴工作衣及防護手套（供處置濕潤狀態之鉍等之勞工應著不浸透性之防護手套）等個人防護具。

第三十七條 雇主使勞工從事特定化學物質之作業時，應指定現場主管擔任特定化學物質作業主管，實際從事監督作業。

雇主應使前項作業主管執行下列規定事項：

- 一、預防從事作業之勞工遭受污染或吸入該物質。
- 二、決定作業方法並指揮勞工作業。
- 三、保存每月檢點局部排氣裝置及其他預防勞工健康危害之裝置一次以上之紀錄。
- 四、監督勞工確實使用防護具。

附表一 特定化學物質

一、甲類物質：

1、黃磷火柴

P

Yellow phosphorus match

2、聯苯胺及其鹽類

$(C_6H_4NH_2)_2$

Benzidine and its salts

3、4-胺基聯苯及其鹽類

$C_{12}H_9NH_2$

4-Aminodiphenyl and its salts

4、4-硝基聯苯及其鹽類

$C_{12}H_9NO_2$

4-Nitrodiphenyl and its salts

5、β-萘胺及其鹽類

$C_{10}H_7NH_2$

β-Naphthylamine and its salts

6、二氯甲基醚

$ClCH_2OCH_2Cl$

bis-Chloromethyl ether

7、多氯聯苯

$C_{12}H_nCl_{(10-n)} (0 \leq n \leq 9)$

Polychlorinated biphenyls

8、氯甲基甲基醚

$ClCH_2OCH_3$

Chloromethyl methyl ether

9、青石綿、褐石綿

3MgO · 2SiO₂ · 2H₂O、

(FeO · MgO) SiO₂

Crocidolite、Amosite

10、甲基汞化合物

CH₃HgX, (CH₃)₂Hg

(X:H₂PO₄, Cl 等)

Methyl mercury compounds

11、五氯酚及其鈉鹽

C₆Cl₅OH

Pentachlorophenol and its sodium salts

12、含苯膠糊[含苯容量占該膠糊之溶劑(含稀釋劑)超過百分之五者。]

13、含有 2 至 11 列舉物占其重量超過百分之一之混合物。

二、乙類物質：

1、二氯聯苯胺及其鹽類

(C₆H₃ClNH₂)₂ Dichlorobenzidine and its salts

2、α-萘胺及其鹽類

C₁₀H₇NH₂

α-Naphthylamine and its salts

3、鄰-二甲基聯苯胺及其鹽類

(C₆H₃(CH₃)NH₂)₂

o-Tolidine and its salts

4、二甲氧基聯苯胺及其鹽類

(C₆H₃(NH₂)OCH₃)₂

Dianisidine and its salts

5、鈹及其化合物

Be

Beryllium and its compounds

6、三氯甲苯

$C_6H_5CCl_3$

Benzotrichloride

- 7、含有 1 至 5 列舉物占其重量超過百分之一或鈹合金含鈹占其重量超過百分之三之混合物；含有 6 列舉物占其重量超過百分之〇·五之混合物。

三、丙類物質

(一)丙類第一種物質

1、次乙亞胺

C_2H_5N

Ethyleneimine

2、氯乙烯

CH_2CHCl

Vinyl chloride

3、3,3'-二氯-4,4'-

二胺基苯化甲烷

$C_{13}H_{12}Cl_2N_2$

3,3'-Dichloro-4,4'-diaminodiphenylmethane

4、四羰化鎳

$Ni(CO)_4$

Nickel carbonyl

5、對-二甲胺基偶氮苯

$C_6H_5N_2C_6H_4N(CH_3)_2$
p-Dimethylaminoazobenzene

6、β-丙內酯

$(CH_2)_2CO_2$
β-Propiolactone

7、丙烯醯胺

$CH_2CHCONH_2$
Acrylamide

8、丙烯腈

CH_2CHCN
Acrylonitrile

9、氯

Cl_2
Chlorine

10、氰化氫

HCN
Hydrogen cyanide

11、溴甲烷

CH_3Br
Methyl bromide

12、2,4-二異氰酸甲苯或 2,6-二異氰酸甲苯

$C_6H_3CH_3(NCO)_2$
Toluene 2,4-diisocyanate
or Toluene 2,6-diisocyanate

13、4,4'-二異氰酸二苯甲烷

$CH_2(C_6H_4NCO)_2$
4,4'-Methylene bisphenyl diisocyanate

14、二異氰酸異佛爾酮

$(CH_3)C_6H_7(CH_3)(NCO)CH_2(NCO)$

Isophorone diisocyanate

15、異氰酸甲酯



Methyl isocyanate

16、碘甲烷



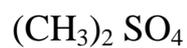
Methyl iodide

17、硫化氫



Hydrogen sulfide

18、硫酸二甲酯



Dimethyl sulfate

19、四氯化鈦



Titanium tetrachloride

20、氧氯化磷



Phosphorus oxychloride

21、環氧乙烷



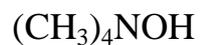
Ethylene oxide

22、苯



Benzene

23、氫氧化四甲銨



Tetramethylammonium hydroxide

24、溴化氫

HBr
Hydrogen bromide

25、三氟化氯

ClF₃
Chlorine trifluoride

26、對一硝基氯苯

C₆H₄ClNO₂
p-Nitrochlorobenzene

27、氟化氫

HF
Hydrogen fluoride

28、含有 1 至 21 列舉物佔其重量超過百分之一之混合物；含有 22 列舉物體積比超過百分之一之混合物；含有 23 列舉物佔其重量超過百分之二點三八之混合物；含有 24、25 列舉物佔其重量超過百分之四之混合物。含有 26、27 列舉物佔其重量超過百分之五之混合物。

(二)丙類第二種物質

1、奧黃

[(CH₃)₂NC₆H₄]₂CNH
Auramine

2、苯胺紅

C₂₀H₁₉N₃
Magenta

3、含有 1 及 2 列舉物佔其重量超過百分之一之混合物。

(三)丙類第三種物質

1、石綿（不含青石綿、褐石綿）



Asbestos (not including Crocidolite and Amosite)

2、鉻酸及其鹽類



Chromic acid and chromates

3、砷及其化合物



Arsenic and its compounds

4、重鉻酸及其鹽類



Dichromic acid and its salts

5、乙基汞化合物



Ethyl mercury compounds

6、鄰一二腈苯



o-Phthalonitrile

7、鎘及其化合物



Cadmium and its compounds

8、五氧化二釩



Vanadium Pentaoxide

9、汞及其無機化合物（硫化汞除外）



Mercury and its inorganic compounds (Except mercury sulfide)

10、硝基乙二醇



Nitroglycol

11、錳及其化合物 (一氧化錳及三氧化錳除外)

Mn

Manganese and its compounds (Except manganese monoxide,
manganese trioxide)

12、鎳及其化合物(四羰化鎳除外)

Nickel and its compounds (except nickel carbonyl)

13、煤焦油

Coal tar

14、氰化鉀

KCN

Potassium cyanide

15、氰化鈉

NaCN

Sodium cyanide

16、含有 1 至 12 列舉物占其重量超過百分之一之混合物；含有 13 至

15 列舉物占其重量超過百分之五之混合物。

四、丁類物質：

1、氨

NH_3

Ammonia

2、一氧化碳

CO
Carbon monoxide

3、氯化氫

HCl
Hydrogen chloride

4、硝酸

HNO₃
Nitric acid

5、二氧化硫

SO₂
Sulfur dioxide

6、光氣

COCl₂
Phosgene

7、甲醛

HCHO
Formaldehyde

8、硫酸

H₂SO₄
Sulfuric acid

9、酚

C₆H₅OH
Phenol

10、含有 1 至 8 列舉物占其重量超過百分之一之混合物；含有 9 列舉物占其重量超過百分之五之混合物。